

## 高純度金屬與化合物蒸鍍材料

以下由我司供應之材料，特別適用於電子槍與熱蒸鍍機台之蒸鍍源，  
主要分為以下大類：

### 1. 貴金屬材料

元素	密度(g/cm <sup>3</sup> )	純度	尺寸
Au	19.32	依照不同金屬特性，可提純製作不同之純度 99%~99.99999%	依照不同金屬特性，可生產製作為顆粒，錠狀，濺鍍靶材。
Ag	10.50		
Pt	21.45		
Pd	12.02		
Rh	12.44		

### 2. 其他非貴金屬之單一元素材料

元素	密度(g/cm <sup>3</sup> )	純度	尺寸
Al	10.50	依照不同金屬特性，可提純製作不同之純度 99%~99.99999%	依照不同金屬特性，可生產製作為顆粒狀，錠狀，濺鍍靶材。
Cr	7.10		
Cu	8.96		
Ga	5.90		
In	7.31		
Mg	1.74		
Mo	10.22		
Ni	8.90		
Sn	7.30		
Si	2.57		
Ti	4.51		
W	19.1		

※以上僅列出光電半導體常用之品項，尚有其他各種元素材料，歡迎來電洽詢。

## 高純度金屬與化合物蒸鍍材料

以下由我司供應之材料，特別適用於電子槍與熱蒸鍍機台之蒸鍍源，主要分為以下大類：

### 3. 金屬合金類材料

金基合金	AuAg, AuBe, AuGe, AuGeNi, AuPt, AuPd, AuSn, AuZn,
銀基合金	AgPd, AgAl, AgPdCu,
鋁基合金	AlCu, AlSi, AlSiNi,
銅基合金	CuAl, CuNi, CuSn,
鈀基合金	PdCu, PdPt,
鉑基合金	PtAl, PtRh,
錫基合金	SnCu, SnAgCu, SnBi, SnPt, SnIn, SnNi,

※以上僅列出光電半導體常用之品項，尚有其他不同之合金種類與比例，歡迎來電洽詢。

### 4. 化合物類材料

元素	密度(g/cm <sup>3</sup> )	折射率 n
SiO <sub>2</sub>	2.65	1.45
TiO <sub>2</sub>	4.23	2.2~2.3
Ti <sub>3</sub> O <sub>5</sub>	4.89	2.2~2.3
Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	4.60	2.3
Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	8.20	2.3
ZnS	4.09	2.4
ZrO <sub>2</sub>	5.68	1.95-2.05
MgF <sub>2</sub>	3.15	1.38
SrF <sub>3</sub>	4.24	1.48

※以上僅列出光電半導體常用之品項，尚有其他化合物材料，歡迎來電洽詢。